

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2007年3月8日 (08.03.2007)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2007/026569 A1

- (51) 国際特許分類:  
B24B 37/00 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)  
C08G 18/65 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2006/316372
- (22) 国際出願日: 2006年8月22日 (22.08.2006)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:  
特願2005-249046 2005年8月30日 (30.08.2005) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東洋ゴム工業株式会社 (TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 Osaka (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 小川 一幸 (OGAWA, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市

西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 下村 哲生 (SHIMOMURA, Tetsuo) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 中井 良之 (NAKAI, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP). 中森 雅彦 (NAKAMORI, Masahiko) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合研究所内 Shiga (JP). 山田 孝敏 (YAMADA, Takatoshi) [JP/JP]; 〒5200292 滋賀県大津市堅田二丁目1番1号 東洋紡績株式会社総合研究所内 Shiga (JP).

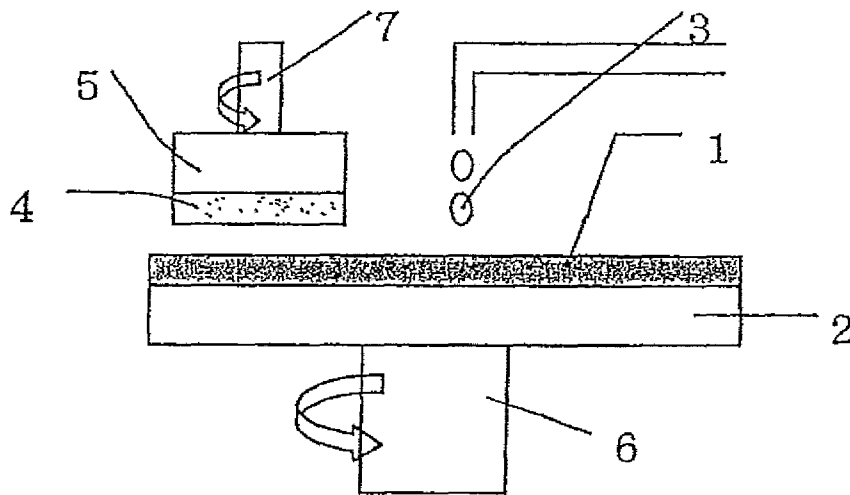
(74) 代理人: 鈴木 崇生, 外 (SUZUKI, Takao et al.); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13-9 新大阪MTビル1号館 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

[ 続葉有 ]

(54) Title: POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 研磨パッド



(57) Abstract: Disclosed is a polishing pad which is free from center-slow problems while having a good polishing rate and excellent life characteristics. Specifically disclosed is a polishing pad having a polishing layer which is made of a polyurethane resin foam having fine air bubbles. A high molecular weight polyol component as a raw material component for the polyurethane resin foam contains a hydrophobic high molecular weight polyol A having a number-average molecular weight of 550-800 and another hydrophobic high molecular weight polyol B having a number-average molecular weight of 950-1,300 at a weight ratio A/B of 10/90-50/50.

(57) 要約: 研磨速度が良好であり、センタースローが発生せず、さらに寿命特性に優れる研磨パッドを提供することを目的とする。本発明の研磨パッドは、微細気泡を有するポリウレタン樹脂発泡体からなる研磨層を有しており、前記ポリウレタン樹脂発泡体の原料成分である高分子量ポリオール成分は、数平均分子量550~800の疎水性高分子量ポリオールA及び数平均分子量950~1300の疎水性高分子量ポリオールBをA/B=10/90~50/50の重量比で含有する。



WO 2007/026569 A1



DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,

CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。